

【特徴】 導体銅が完全に E T されず、途中まで E T された状態で残っている残銅

【特征】 导线铜没有被完全地 ET, 或者 ET 过程中的残余铜。

【Characteristics】 A copper conductor is not completely etched and partially remains.

【原因・判断ポイント・発生工程】 材料銅箔の中、あるいは表面に付着した何らかの異物により、E T が阻害され出来たもの（材料製造工程～E T 工程）

【原因、判断要点、发生工序】 材料铜箔的中间或者表面粘附某种杂物，妨碍 E T 而引起的（材料制造工序～E T 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 Etching is disturbed by a foreign object trapped in copper foil or attached to its surface. (Copper material manufacturing - etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

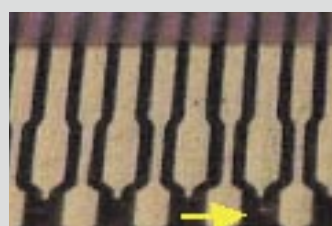
【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
FPC
FPC 顕微鏡倍率 ×

【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×

【Comments】
FPC
Magnification: ×